

2019年5月21日

開催案内 ワークショップ NGL2019

応用物理学会次世代リソグラフィ（NGL）技術研究会では、今年もNGL ワークショップ（ワークショップ NGL2019）を開催いたします。本年も多くの方々に参加していただきたく、3件の基調講演と鈴木章義氏のFritz Zernike賞受賞講演をはじめ、充実したプログラムを準備いたしました。皆様のご参加をお待ちしております。

応用物理学会 次世代リソグラフィ技術研究会
幹事長 松井 真二

記

会期：2019年7月4日（木）、5日（金）

会場：東工大蔵前会館*（東急目黒線、大井町線大岡山駅前）

*詳細については蔵前会館のホームページ（下記 URL）をご覧ください。

<http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/access/index.html>

プログラム概要：

・基調講演（7/4）：

“中国製造 2025 の行方” 金 堅敏氏（株式会社富士通総研）

“半導体ストレージの未来を拓くプロセス技術” 橋本 耕治氏（東芝メモリ株式会社）

“AI/IoT 時代における脳型デバイスのパッケージング技術”

折井 靖光氏（長瀬産業株式会社）

・Fritz Zernike賞受賞記念講演（7/5）

“EUV はいかにしてリソグラフィになった？か。露光装置の歴史より”

鈴木章義氏（ASLC）

・技術セッション：

7/4 光リソグラフィ & アドバンストパターニング、DSA&レジスト、ポスターセッション*

7/5 ナノインプリント、EB・計測・マスク技術、EUVL

*ポスターセッションでは軽食を提供いたします。

主催：応用物理学会 次世代リソグラフィ技術研究会（分科会）

協賛：応用物理学会 シリコンテクノロジー分科会

応用物理学会 極限ナノ造形・構造物性研究会

日本学術振興会 「荷電粒子ビームの工業への応用」 第132委員会

NGL2019企画運営委員会：

委員長：松井 真二 副委員長：岡崎 信次

委員：石原 直、井谷 俊郎、伊藤 高臣、老泉 博昭、落合 幸徳、古澤 孝弘、酒井 啓太、

榎原 慎、笑喜 勉、渋谷 真人、田川 精一、瀧川 忠彦、原田 哲男、廣島 雅人、

堀内 敏行、松山 知行、宮本 恭幸、尹 成圓、藤井 清

事務局：相良好美

〒335-0021 埼玉県戸田市新曽 45

TEL : 090(5493)1147

FAX : 048(443)4204

E-mail : zx10453@nifty.com、ngl@jsap.or.jp

参加費※：

主催・協賛団体会員、学生： 3,000円（6月14日以前の申し込み）

4,000円（6月15日以降の申し込み）

一般： 18,000円（6月14日以前の申し込み）

20,000円（6月15日以降の申し込み）

*申し込み後、7月1日までに銀行振り込みでお支払いください。

申し込み方法：下記の申し込み専用ホームページからお申し込みください。

<https://annex.jsap.or.jp/limesurvey/index.php/277712/lang-ja>

応用物理学会次世代リソグラフィ技術研究会は、本ワークショップの他、年に3回程度、会員が無料で参加できる定例研究会を開催しております。当研究会には、法人会員、個人会員としての入会が可能です。ご興味をお持ちの方は、上記事務局までご連絡ください。

以上

東京工業大学 東工大蔵前会館 案内図

